

Waxless Mount Semiconductor Polishing Templates



PR.HOFFMAN 单面抛光垫（或抛光模板）使用 指导

储存于干燥的环境， 常温：18-25摄氏度。

应避免高、低温环境的影响。如有经历过高、低温，使用前请放置于常温环境至少24小时为好。

储存时间最好不要超过6个月。

平时不使用时，请不要拆封原包装。

抛光盘的清理注意：

要保证抛光盘的干燥和洁净。

最佳方法：推荐使用异丙醇，正庚烷或者水来进行抛光盘的最后擦拭。

为使用效果更佳，可使用电热吹风机干燥和温暖盘面，21-38度最好。

目的是清除掉湿痕和还原可能由于使用异丙醇擦拭造成的盘面温度较低。

装盘方法和注意：

工作间温度应该在21-38度。

慢慢揭开抛光垫背面的黄色不干胶，先揭开1/3，由此1/3处开始往抛盘上贴，并一边贴，一边揭去黄色的不干胶。用力均匀，并避免贴时，内有气孔。

有气孔，也不要紧，用针挑破，用手指赶出来即可。

达到最佳的粘接效果：

为更好的使抛光垫或抛光模板与盘面牢固粘合，粘上后，在使用前放置约72小时，可达到粘接力最强的效果。另外，在粘贴上后，在整个盘面加些力或适当的重物也能增强抛光垫或模板上面的保持架（玻璃钢）部分与整体的粘接强度。

注意：粘帖最少3个小时后，才可用水淋湿。

检查气泡：

用DI 水淋湿抛光垫或模板，检查工作孔内是否有气泡。如有，可用针挑破，并用手指赶出气泡内气体。

用DI 水冲洗时，也与细软毛刷一起使用。

注意，抛光垫或模板不能重复揭掉和重贴。

装片：

抛光垫或模板淋湿后，用手把晶片放进“口袋中”，同时有压“拧”的动作，不仅能挤出过多的水分，也能使片子吸牢。

Waxless Mount Semiconductor Polishing Templates



取片注意：

不要弄破抛光垫口袋内衬料或黑色抛布。可用DI 水流轻轻冲晶片的边缘，以利于取片。也不要弄损，弄破抛光垫的玻璃钢的保持架，以便反复利用。

每一次抛光后的清洗：

每抛光完一次，可用细软刷子加上DI 水，清扫“口袋”内的残留物。

临时不用时的处理：

如需要临时不用此盘，且超过1小时时，建议用塑料布等盖好，以免不要很快干掉。也可放入密封的塑料袋内保湿。

（但注意，不能用每次揭掉和重新粘贴的方式来处理一次抛光后的抛光垫或模板。）

在用时，从袋子中取出，加湿和轻微用软刷擦拭一下即可。

最佳工艺温度选项：（加工蓝宝石产品，我们有高温和常温的TEMPLATE）。

1.常温 TEMPLATE

为了达到最佳的使用效果，当工艺温度低于 50 摄氏度时，P.R.HOFFMAN 推荐采用常温无蜡抛光垫或模板加工晶片。

2.高温 TEMPLATE 产品

为了达到最佳的使用效果，当工艺温度高于50摄氏度时，P.R. HOFFMAN 推荐采用高温产品来加工晶片。

这些指导可以帮助无蜡抛光垫保持最长的使用寿命。我们明白每个公司有自己的加工程序，但是我们仍然建议贵公司可以仔细阅读并配合使用指导。我们的目标是帮助贵公司使用我们的产品达到最佳效果。

有问题，请致电：13501936066，上海021-58215671。

These recommendations are subject to change or revision without notice.
© 2003 – PR Hoffman Machine Products, all rights reserved.

1517 Commerce Avenue • Carlisle, PA 17015

• Phone: (717) 243-9900 • FAX (717) 243-4542